A

메타표면 격자의 기하학을 최적화하여 최대 회절 효율과 각도 응답의 균일성을 달성하기 위해, 우리는 엄밀 결합 파동 해석 솔버를 사용합니다. 우리의 메타표면 결합기는 횡전기 편광 모드에서 작동하여 보다 균일한 광학 응답을 제공합니다. 최적화 과정은 2D 공간 도메인에서 무작위로 초기화된 기하학에서 시작하여 Adam 솔버를 사용하여 메타표면 격자의 프로파일을 정제하는 경사하강법을 사용합니다. 최적화 루프의 손실 함수는 빨강, 초록 및 파랑 파장(638 nm, 521 nm 및 445 nm)에 대한 첫 번째 회절 차수 효율의 합을 최대화하면서, 이 세 가지 파장에 대해 -5°에서 5°까지의 다양한 입사각에 대한 효율의 표준 편차를 최소화합니다. 우리는 x 축 대칭을 가정하여 설계 과정을 1 차원으로 단순화하고, 가우시안 블러를 추가하여 이러한 대면적 메타표면의 제조 공차를 고려합니다. 결과적으로 Fig. [2c]에 나타난 것처럼 이중선 메타표면 격자로 수렴되었습니다. 이 기하학은 전기장 프로파일과 중첩된 포인팅 벡터(Fig. [2b])에 의해 확인된 바와 같이, 빨강, 초록 및 파랑 파장에 대해 입사파를 높은 회절 각도로 유도하는 메타표면 결합기를 제공합니다. 중요한 것은, 최적화된 비대칭 나노구조가 한 방향에서 회절 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 입사각에 대한 균일성도 개선한다는 점입니다.

B

metasurface gratings 의 최대 회절 효율과 각도 응답의 균일성을 최적화하기 위해, 우리는 rigorous-coupled-wave-analysis solver 를 사용합니다. 우리의 metasurface couplers 는 보다 균일한 광학적 응답을 제공하기 위해 transverse electric polarization mode 에서 작동합니다. 최적화 과정은 2D 공간 도메인에서 무작위로 초기화된 기하학에서 시작하여 Adam solver 를 사용하여 metasurface gratings 의 프로파일을 정제하는 gradient descent method 를 사용합니다. 최적화 루프의 loss function 은 빨강, 초록 및 파랑 파장(638 nm, 521 nm 및 445 nm)에 대한 첫 번째 회절 차수 효율의 합을 최대화하면서, 이 세 가지 파장에 대해 -5°에서 5°까지의 다양한 입사각에 대한 효율의 표준 편차를 최소화합니다. 우리는 x 축 대칭을 가정하여 설계 과정을 1 차원으로 단순화하고, Gaussian blur 를 추가하여 이러한 대면적 metasurfaces 의 제작 허용 오차를 고려합니다. 결과 설계는 Fig. [2c]에 표시된 것처럼 이중선 metasurface grating 으로 수렴되었습니다. 이 기하학은 Fig. [2b]에 표시된 전기장 프로파일과 중첩된 Poynting vectors 에 의해 확인된 바와 같이 빨강, 초록 및 파랑 파장에 대해 높은 회절 각도로 입사파를 조향하는 metasurface couplers 를 제공합니다. 중요하게도, 최적화된 asymmetric nanostructure 는 한 방향으로 회절 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 입사각에 대한 균일성도 개선합니다.